APPARATUS FOR MEASURING PRECISE DIMENSION

Patent Number:

JP58192747

Publication date:

1983-11-10

Inventor(s):

NAKAOKA JIYUNICHI; others: 02

Applicant(s):

SUMITOMO TOKUSHIYU KINZOKU KK

Requested Patent:

JP58192747

Application Number: JP19820074129 19820430

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/04; G01B21/08

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To measure the thickness of a material to be machined, by providing a distance detector, which is fixed to the central part of a fixing ring through a bearing so as to face a lapping surface table with a specified distance being provided, thereby detecting distance between the detector and the lapping surface plates.

CONSTITUTION: A specified gap is provided at the outer surface of a fixed ring 3 on a lapping surface table 1. A correcting ring 5 for correcting the flatness of the surface table 1 is arranged. An eddy current detector 7 is fixed to the central hole part of the fixed ring 3 through a bearing 6 so that the tip of the detector 7 faces the upper surface of the surface table 1 with a specified distance being provided. The thickness of a material to be measured 2 is decreased by a grinding machining. With the decrease in the distance between the tip part of the detector 7 and the surface of the surface table 1, the voltage of the detector 7 is changed. The changing voltage is inputted in a computing device 8 and an objective grinding quantity and the detected ground quantity are compared. When the ground quantity has reached the objective value, an electric signal is inputted into a control machine 9 and a driving machine is stopped.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

¹² 公開特許公報 (A)

昭58—192747

50Int. Cl.3 B 24 B 37/04 G 01 B 21/08

識別記号

庁内整理番号 7512-3C 7119--2F

43公開 昭和58年(1983)11月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

郅精密寸法測定装置

②特 昭57-74129 願

22出 昭57(1982) 4 月30日

切発 明 者 中岡潤一

大阪府三島郡島本町江川二丁目 15-17住友特殊金属株式会社山

崎製作所内

70発 明 者 菊地勝彦

大阪府三島郡島本町江川二丁目

15-17住友特殊金属株式会社山 崎製作所内

70 発 明 者 佐野孝

> 大阪府三島郡島本町江川二丁目 15-17住友特殊金属株式会社山

崎製作所内

 $\mathfrak{A}_{\mathbb{H}}$ 人 住友特殊金属株式会社

大阪市東区北浜5丁目22番地

⑭代 理 人 弁理士 押田良久

明

1. 発明の名称

精密寸法阅定装置

特許請求の範囲

ラップ定盤に対向して下面に被加工材を尚 着し、上面に錘を載置した鬩定りングの中心部に 軸承を介して、距離検出器を、上 記ラップ定盤と 特定距離をもつて固着し、上配固定リングの外周 に間隙を介してラップ定盤上に修正リングを載置 し、研摩加工時の被加工材とラップ定盤との相対 回転による被加工材の厚み変化量を上記検出器に より検出側定することを特徴とする精密寸法制定 装置。

3. 発明の詳細 た説明

この発明は、ラウビングやメカノケミカルポリ ッシング等の加工中に、被加工材の厚みの最小変 化を非接触で連続して精密に測定する装置に関す る。

磁気ヘッド用材料として、パーマロイ, フェラ イト。センダスト等が用いられ、遊気特性。耐度

耗性。精密加工性等の点から各々特徴を有し、記 録波長,メデイアとの関係や母気ヘッドの用途に よつて使い分けられている。また今日、オーデイ オ。ビデオなよびコンピューター用の磁気ヘッド は磁気紀録密度の向上が求められて⇒り、I.C.テ クノロジーを用いて製造する薄膜磁気ヘッドがと れに最適であると考えられている。

例えば薄膜磁気ヘッド用基板には、メタルより もフェライトが適しており、またかかる基板上に は磁気回路を構成する磁性材料及び非磁性材料あ るいは磁界検出用のL素子等をメッキ。蒸溜。ス パッター等で形成するため、要求される基板表面 の平滑性及び厚み寸法精度が厳しく、さらにフェ ライト磁性基板の磁気特性を向上させるために表 面の無重加工が要求される。

上記の加工方法として、従来はダイヤモンド後 粉を砥粒とする機 彼 研 摩が多用されているが、 研摩加工中において被加工材の単みの関定ができ ないため、厚み側定の場合はその都度研摩機を停 止させ、被加工材を取外して洗浄後、電子マイク

ロメータ等で実測するか、 あるいは予め特定時間 内での研察条件と被加工材の研摩量。 研摩原みと の関係を求め、研摩時間より研摩量又は研摩原み を推定した。

従って、研摩加工時に数回に及ぶ厚み関定のたびに被加工材の洗浄作業及び研摩機の休止等のため、多大の工程を必要とし作業能率が悪く、磁気ヘッド製造上種々の問題を生じていた。

この発明は、かかる現状に鑑み、 ラッピングや メカノケミカルポリッシング等において、被加工 材の 1 µm以下の微少研摩量を非接触連続的にかつ 高精度で側定する測定装置を提案することを目的 とする。

すなわち、この発明は、ラップ定盤に対向させる下面に被加工材を固着し、上面に顔を軟置した固定リングの中心部に軸承を介して距離検出器を上記ラップ定盤と特定距離をもつて固定し、この固定リング外周に間隙を介してラップ定盤上に修正リングを軟置し、研摩加工時の被加工材とラップ定盤との相対回転による被加工材の原み変化量

によるラッピングのほか、例えば SIO 等の類別末の懸間液を使用したメカノケミカルポリッシング等、多種の研摩加工方法に適用でき、被加工材料 もセラミックや金属等多種の材料に適用できる。

以下に、この発明による実施例を図面に基づいて説明する。第1 図は検出器に渦電流検出器を用いたとの発明による測定装置の緩斷説明図である。

便質クロス、Sn、ガラス、セラミック等からなるラップ定盤(1)上に、ステンレス等からなる固定リング(3)を置くが。固定リング(3)下面には Mn ー Zn フェライト、Ni ー Zn フェライト等セラミック被加工材(2)を接着してあり、上面にはステンレス製の錘(4)を敬置してあり、ラップ定盤(1)上に被加工材(2)が接触するように構成している。

さらに、ラップ定盤(I)上に、固定リング(3)の外 周に所定の間隙を設けて、耐摩耗性材料からなる ラップ定盤(I)の平坦度修正のための修正リング(5) を、定盤上に図示しない位置決め用の支持リング に保持させて周配置してある。

との周定リング(3)の中心孔部には軸受等の軸承

を前記検出器により検出例定することを要旨とす る精密寸法例定装置である。

さの発明は、ラップ定盤上に、固定板下面に固 をの発明は、ラップを整上に、固定板下面に固 をしたでではなり、変になったができる。 なせ、研磨加工を行なり、変になったができる。 のの外周部に間隙を設けて修正リングをのまる。 は、のの中心孔部に対するに をして、変になった。 を検出圏をでいてが を使出圏定させる。 を使出圏定させる。 のである。

検出器には、実施例で示す禍電流検出器のほか、 昭育波方式。レーザーホログラフ方式等の非接触 の直線距離検出側定器のいずれのものも使用でき、 側定精度を高めるため複数の検出器を用いるのも よい。

また、検出器の先端部とラップ定盤との所定距離は使用する検出器、検出条件、錘材質等により適宜設定される。

との発明による側定装置は、ダイヤモンド低粒

(6)を懶りて渦電流検出器(7)がその先端をラップ 定盤(1)上面と所定の距離をもつて対向するよう固 定してある。

上紀の構成において研摩加工の場合、フップ定 盤(1)を回転させると、修正リング(5)と供に蠅(4)に より荷重された固定リング(3)の回転により被加工 材(2)は例えばダイヤモンド砥粒により研摩加工さ れ、被加工材(2)の厚みは減少していく。

次に、上述した測定装置を用いて、第1表に示す研察条件で研摩加工を実施した場合の研摩時間。

変動電圧及び研摩量との関係を測定した。その結 果を第2図に示す。

すなわち、この発明による測定装置は、ラップ 定盤の材質にかかわらず±3μm以内の精度まで測 定可能であり、研摩能率向上と共に、検出電圧の 演算処理により研摩作業の自動制御が可能であり、 工業生産に極めて有効である。

第 1 表

彼	DO.		r	材	Ni - Zn フェライト
7	ッ	プ	定	盤	Sn. 盤。回転数 100 rpm
協	定	ij	ン	I	ステンレス製 , 回転数 55 rpm
儊	Æ	ij	ン	7	アルミナ製,回転数55 rpm
		錘			ステンレス製。富量 4年
低				粒	柱 径 2~3 μπ, ダイヤモンド
検	出口器	先;	端部	٤٤	
7	ツブ	定	盤 と	· の	1=
腌				精	

4. 図面の簡単な説明

第1 図はとの発明による測定装置の縦断説明図、 第2 図は実施例装置を使用した被加工材の研摩時間と検出変動電圧。研摩量との関係を示すグラフ である。

図中、1 … ラップ定盤、2 … 被加工材、3 … 固定リング、4 … 無、5 … 修正リング、6 … 軸承、7 … 渦電流検出器、8 … 演算装置、9 … 制 御機。

出願人 住友特殊金属株式会社 代理人 押 田 良 名詞

